



نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوششهای نوین - ۳۲ (۱۳۹۹/۱۳۹۹ - ۲۳۱۰

ایجاد دو لایه Cu₂O-CuO به عنوان فتوکاتد و بررسی خواص فتوالکتروشیمیایی آن

غلامرضا حيدرى

استادیار، گروه مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی، مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین، اسفراین، ایران



تولید هیدروژن بوسیله تجزیه آب تحت نور خورشید با استفاده از نیمه هادیها یک روش امیدوار کننده برای تولید یک انرژی پاک و تجدیدپذیر میباشد. Cu_2O یک نیمه هادی مثبت میباشد که به واسطه موقعیت نوار هدایت میتواند به عنوان فتوکاتد در تجزیه آب استفاده شود. در این تحقیق Cu_2O به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی سنتز شد و الگوی پراش اشعه ایکس بیانگر خلوص لایهی Cu_2O میباشد. به منظور ایجاد دو لایه Cu_O-CuO و بهبود خاصیت فتوالکتروشیمیایی،

واژگان کلیدی

چکندہ

دو لایه Cu₂O-CuO، فتوکاتد، تجزیه آب تحت نور خورشید، رسوبدهی الکتروشیمیایی

<mark>تاریخ دریافت:</mark> ۹۸/۰۵/۱۶

تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۹/۱۳





Synthesis of Cu₂O-CuO Two Layer as Photocathode and Investigation of Its Photoelectrochemical Properties

Gh. Heidari

Assistant Professor, Materials Department, Esfarayen University of Technology, Esfarayen, Iran

Production of hydrogen through photoelectrochemical water splitting using a semi-Abstract conductor is a promising method for production of clean and renewable energy. Cu₂O is a positive semiconductor that its conduction band position is suitable for photoelectrochemical reduction of water. In this study, Cu₂O was synthesized using electrochemical deposition and it was heat treated at 450 °C for 30 min to obtain two layer Cu₂O-CuO and improve its photoelectrochemical property. Oxidation of Cu2O resulted in two layer Cu2O-CuO. The x-ray pattern of the electrodeposited layer showed a pure Cu₂O layer. Scanning electron microscopy showed a microstructure change after heat treatment and the particle size was in nanometer scale. Photocurrent density was measured using linear sweep voltammetry under chopped illumination and it was concluded that the photocurrent density of the heat treated sample at 450 °C was increased to 731 µA.cm⁻². Electrochemical impedance spectroscopy at constant potential and frequency range of 0.1-105 Hz and also at fixed frequency and potential range of -0.3V up to 0.5V was performed to study charge transfer characteristic of the photocathode and to determine the flat band potential and carrier density. Carrier density of Cu₂O and Cu₂O-CuO was determined to be 1.3×10^{18} cm⁻³ and 3.05×10^{18} cm⁻³, respectively and the flat bend potential of Cu₂O and Cu₂O-CuO was determined to be 0.19V and 0.23V, respectively.

Keywords

Two layer Cu₂O-CuO, Photocathode, Photoelectrochemical water splitting, Electrochemical deposition

۱ – مقدمه

امروزه برای تولید هیدروژن در مقیاس صنعتی، از فناوریهای آلاینده استفاده می شود که از انرژیهای تجدیدناپذیر استفاده می کنند. تجزیه فتوالکتروشیمیایی آب توسط نور خورشید که منجر به شکستن مولکولهای آب به گازهای هیدروژن و اکسیژن می شود، به عنوان یکی از بهترین فناوریها برای تولید هیدروژن پاک و تجدیدپذیر مطرح است. در این روش با استفاده از یک نیمه هادی، انرژی خورشید می تواند مستقیما به انرژی الکتروشیمیایی برای تفکیک آب تبدیل شود [۱, ۲]. نیمه هادیهای مختلفی شامل اکسید تیتانیم، اکسید آهن، اکسید روی، اکسید مس، اکسید تنگستن و غیره برای تجزیه فتوالکتروشیمیایی آب استفاده شده اند.

یکی از نیمه هادیهایی که بدین منظور استفاده می شود اکسید مس میباشد. اکسیژن به دو روش با مس ترکیب شده و دو ماده متفاوت میدهد، یکی Cu₂O که معمولا به صورت پودر قرمز رنگ و دیگری CuO که به رنگ سیاه است. این دو ماده به صورت معدنی معمولا به حالت کریستالی یافت می شوند. در میان اکسیدهای فلزات واسطه، CuO به دلیل خواص جالب و بیهمتا به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. این اکسید دارای ساختار مونوکلینیکی است و یک نیمه هادی نوع مثبت میباشد و گاف نوار انرژی آن ۱/۹–۱/۲ الکترون ولت است. Cu₂O دارای ساختار مکعبی با ثابت شبکه ۴/۲۷ آنگستروم و گاف نوار انرژی ۲ الکترون ولت میباشد و دارای ضریب جذب نوری بالا در ناحیه مرئی و خاصیت الکتریکی خوب میباشد [۳, ۴]. به طور کلی این دو اکسید مس، در سلولهای خورشیدی [۵–۷]، به عنوان فتوکاتالیست برای احیای آب [۸, ۹]، حسگرهای گازی و ترانزیستورهای اثر میدان استفاده می شوند [۳, ۱۰]. روشهای مختلفی از قبیل سل ژل [۱۱]، هیدروترمال [۱۲]، اسپری پیرولیز [١٣]، رسوبدهی الکتروشیمیایی [١۴]، سونوشیمی [۱۵]، واکنش یک مرحله ای حالت جامد [۱۶]، ریز موج [۱۷]، میکروامولسیون [۱۸] و غیره جهت سنتز اکسیدهای مس استفاده شدهاند. رسوبدهی الکتروشیمیایی از جمله روشهای ارزان، آسان و با قابلیت صنعتی شدن بالا میباشد که می توان از آن جهت تولید پوششهای فلزی، غیر فلزی و کامپوزیتی با اهداف مختلف استفاده نمود.

از روش رسوب دهی الکتروشیمیایی به منظور ایجاد لایه ناز ک Cu_2O و u_2O و سپس عملیات حرارتی جهت ایجاد Cu_2O –CuO استفاده شده است [۱۹]. در این تحقیق رسوب دهی الکتروشیمیایی Cu_2O بصورت متفاوت انجام شده است. قبل از اعمال پتانسیل ثابت، از تکنیک ولتامتری چرخه ای به منظور فراهم آوردن جوانه های اولیه استفاده گردید. سپس به منظور ایجاد CuO، لایه ناز ک O_2O تحت عملیات حرارتی قرار گرفته شد.

۲- روش تحقیق ۲-۱- سنتز دو لایه Cu,O-CuO

رسوب
دهی الکتروشیمیایی اکسید مس (Cu2O) در یک محلول آبی pH=۱۰ مس (
 $(\cdot / 1 \ M)$ در $(\cdot / 1 \ M)$ در $(\cdot / 1 \ M)$

انجام گردید. به منظور تنظیم PH از هیدروکسید سدیم استفاده شد. رسوبدهی الکتروشیمیایی به کمک دستگاه پتانشیواستات SAMA500 در پتانسیل ثابت احیایی ۲/۰- ولت به مدت زمان است انبه انجام گرفت. قبل از فرآیند رسوبدهی زیرلایههای اکسید قلع دوپ شده با فلوئور، در سه مرحله توسط آب و ماده شوینده و استون به صورت آلتراسونیکی شستشو داده شدند و سپس به عنوان الکترود کاری استفاده شد. از الکترود (Ag/AgCl) به عنوان مرجع و یک سیم پلاتینی به عنوان الکترود کمکی استفاده گردید. قبل از اعمال پتانسیل ثابت، ولتامتری سیکلی از ۲۰ ا ۸/۰- ولت با نرخ از اعمال پتانسیل ثابت، ولتامتری سیکلی از ۲۰ ا ۸/۰- ولت با نرخ یوشش ها به رنگ نارنجی در آمدند. جهت بدست آوردن اکسید مس دو ظرفیتی (CuO)، نمونههای اکسید مس رسوبدهی شده (Cu₂O) به مدت ۳۰ دقیقه در دماهای ک[°] ۲۵۰، ۶۵۰ هر ۵۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰، ۳۵۰

۲-۲- مشخصه یابی و آزمون فتوالکتروشیمیایی

از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) جهت تعیین نوع ترکیب و فاز استفاده گردید. همچنین با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ریختشناسی سطحی نمونهها مورد ارزیابی قرار گرفت. منحنی جذب نور لایه بدست آمده توسط دستگاه طیف سنج ماوراء بنفش-مرئی APEL PD-303UV بدست آمد. جهت بررسی خواص فتوالکتروشیمیایی اکسیدهای مس، از پتانشیواستات Autolab مس به عنوان الکترود کاری، Ag/AgCl به عنوان الکترود مرجع و یک ورقه پلاتینی به عنوان الکترود کمکی استفاده گردید. تمام اندازه گیریها در محلول سولفات سدیم (۱ ۸) در دمای اتاق و تحت نور مرئی و بدون نور، انجام شد. آزمونهای فتوالکتروشیمیایی در یک سطح ثابت (۲۰۶۵ ۲۰۵) انجام شد.

۳- نتايج و بحث

رسوبدهی الکتروشیمیایی به منظور ایجاد لایه نازک Cu₂O در پتانسیل ثابت انجام شد. به منظور فراهم آوردن جوانههای اولیه قبل از اعمال پتانسیل ثابت، یک آزمایش ولتامتری چرخهای انجام شد. شکل ((a) تصویر لایه نازک Cu₂O ایجاد شده به این روش را نشان میدهد. به منظور مقایسه، رسوبدهی الکتروشیمیایی در پتانسیل ثابت بدون استفاده از ولتامتری چرخهای نیز انجام گردید که در شکل ((b) نشان داده شده است. همچنانکه از این تصاویر مشخص می باشد، لایه نازک ایجاد شده توسط روش ارائه شده در این مقاله شفاف و یکنواخت می باشد. آزمایش ولتامتری چرخهای در نمونه مربوط به شکل ((a) منجر به ایجاد جوانههای اولیه و در نهایت یکنواخت شدن دانهها

نهایت افزایش شفافیت می گردد.

جهت ایجاد لایه Cu_2O از اسید لاکتیک به عنوان یک عامل پایدار Cu- کننده به منظور ممانعت از ایجاد رسوب $_2(OH)_2$ و تشکیل Lac $_2$ به عنوان یک کمپلکس پایدار استفاده گردید. واکنش های الکتروشیمیایی تشکیل Cu_2O بصورت زیر می باشند [۲۰]: $CuLac_2 + OH^- + e^- \longrightarrow CuOH + 2Lac^-$ (۱)

$$2CuOH \longrightarrow 2Cu_2O + H_2O \tag{(Y)}$$

به منظور ایجاد لایه CuO و افزایش کارایی فتوالکتروشیمیایی، نمونه ها تحت عملیات حرارتی قرار گرفته شدند. شکل ۲ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پوشش های اکسید مس را نشان میدهد که شکل



شکل ۱: تصویر لایه نازک Cu₂O رسوبدهی شده در پتانسیل ثابت به مدت ۱۰۰۰ ثانیه (a) بعد از ولتامتری چرخهای و (b) بدون استفاده از ولتامتری چرخهای.

(a) ۲ مربوط به نمونه رسوب دهی شده بصورت الکتروشیمیایی می باشد و شکل (d) ۲ مربوط به نمونه رسوب دهی شده بعد از عملیات حرارتی در دمای C° ۴۵۰ به مدت ۳۰ دقیقه می باشد. همانطور که از تصاویر مشخص می باشد اندازه دانهها در محدوده نانومتری می باشد. نمونه رسوب دهی شده (شکل (۲(a)) به لحاظ اندازه دانه یکنواخت تر می باشد و همچنین دارای چند نقطه سیاه رنگ می باشد که بنظر فرورفتگی های عمیق یا حفرات می باشند. بعد از عملیات حرارتی اکسید مس و هری یک ظرفیتی OLD طبق واکنش (۳) به اکسید مس دو ظرفیتی یک ظرفیتی OLD جبو می دهد و اکسید مس Cu کسیژن از اتمسفر رخ می دهد و اکسید مس OLD جوانه زده و رشد می کند که منجر به ایجاد فرورفتگی و برآمدگی های بیشتر و همچنین درشت شدن دانهها می شود.

 $Cu_2O + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow 2CuO$ (۳) به منظور تعیین فاز نمونههای رسوبدهی شده و عملیات حرارتی شده آنالیز پراش اشعه ایکس انجام گرفت. شکل ۳ الگوی پراش اشعه ایکس را نشان میدهد. الگوی پراش (a) مربوط به نمونه رسوبدهی شده الکتروشیمیایی میاشد که بیانگر وجود زیرلایه FTO و فاز اکسید مس یک ظرفیتی Cu₂O (۱۵۳۱–۰۷۵–۰۱



شکل ۲: نمونه رسوبدهی شده الکتروشیمیایی (a) و نمونه عملیات حرارتی شده در دمای C[°] ۴۵۰ به مدت ۳۰ دقیقه (b).



شکل ۲: الگوی پراش اشعه ایکس نمونه رسوبدهی شده الکتروشیمیایی (a) و نمونه عملیات حرارتی شده در دمای C[°] ۴۵۰ به مدت ۳۰ دقیقه (b).

Ref.Code:) میباشد. همچنان که از الگوی پراش مشخص میباشد هیچگونه فاز دیگری مربوط به Cu و Cu مشاهده نمیشود. الگوی پراش (b) مربوط به نمونه عملیات حرارتی شده میباشد که همچنان پیکهای مربوط به زیرلایه مشخص میباشد. علاوه بر آن پیکهای مربوط به اکسید مس دو ظرفیتی میباشد. علاوه بر آن پیکهای مربوط به اکسید مس دو ظرفیتی میباشد. علاوه بر آن پیکهای مربوط به اکسید مس دو ظرفیتی افز 0.2 میباشد. علاوه بر آن پیکهای مربوط به اکسید مس دو ظرفیتی افز 0.2 میباشد. علاوه بر آن پیکهای مربوط به اکسید مس دو ظرفیتی یعباشد. علاوه بر آن پیکهای مربوط به اکسید مس دو ظرفیتی میباشد. علاوه بر آن پیکهای مربوط به اکسید مس دو نفرفیتی یواز 0.2 میباشد. اگر تبدیل میباشد. اگر تبدیل یواز 0.2 میباشد. اگر تبدیل میباند ولی وازی تبدیل الگوی پراش اشعه ایکس در نمونههای عملیات حرارتی شده انجام شده در مرجع [14] وجود فاز 0.2 تایید شده است. در این پیکهای مربوط به ایکس در نمونه عملیات حرارتی شده مرجع [14] نیز الگوی پراش اشعه ایکس در نمونه عملیات حرارتی شده مقطع موجود فاز 0.2 تایید نموده است. در این بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در نمونه عملیات حرارتی شده دی بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در نمونه عملیات حرارتی شده در این ایر لایه Tues که در نمونه عملیات حرارتی میباشد. اگر که علی الاز 0.2 میباشد. اگر تبدیل این تایخ تعیقات الگوی پراش اشعه ایک در نمونه عملیات حرارتی شده دو وجود فاز 0.2 میباشد ولی نتایخ Tues در این شده بین زیرلایه Tues (Xues and the section of th

میدهد. همانطور که این شکل نشان میدهد مقدار جذب نور در محدوده مرئی در دو لایه Cu_2O-CuO بیشتر از Cu_2O می باشد که این میتواند منجر به تولید جفت الکترون-حفره بیشتر در اثر تابش نور مرئی شود. گاف نوار انرژی Cu_2O و Cu_2O-CuO با استفاده از رابطه تاک تعیین گردیدند.

(*) (*)
$$(\alpha h \upsilon)^n = A (h\upsilon - E_g)$$
 (*)
که در آن ۵، ۸۰ A و Eg به ترتیب ضریب جذب، انرژی فوتون،
یک عدد ثابت و گاف نوار انرژی میباشند. مقدار n برای نیمه
هادیهای با انتقال مستقیم ۲ میباشد. مطابق با رابطه تاک
 $(\alpha h \upsilon)^2$ بر حسب ۸۷ رسم گردیدند و گاف نوار انرژی با استفاده از
برونیابی قسمت خطی منحنی تا محور x (شکل های داخلی) تعیین
گردید. گاف نوار انرژی Cu_2O و CuO-CuO به ترتیب به مقدار
 $(\alpha V)^2$ و V9 ۳۷ رست آمدند که در گستره گاف نوار انرژی
گزارش شده مربوط به O_2 u و CuO میباشند [۲۱]. همچنین
میتوان لبههای نوار هدایت و ظرفیت را با استفاده از روابط زیر
تعیین نمود [۲۳, ۳۲].







جهت تعیین میزان حساسیت به نور، آزمون پتانسیل روبشی خطی تحت قطع و وصل نور مرئی در محلول (Na₂SO₄ (۱ M) برای نمونههای عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف انجام گرفت. افزایش جریان در اثر تابش نور به دلیل تجزیه آب میباشد. در اثر تابش نور به سطح فتوكاتد الكترون و حفره ایجاد می شود كه به واسطهی خمش نوارهای ظرفیت و هدایت و ایجاد ناحیه بار فضایی الكترون و حفره از هم جدا مىشوند. الكترون به سمت سطح فتوكاتد و حفره مثبت به سمت زيرلايه هادي و درنتيجه الكترود كمكي حركت ميكند. الكترون روى سطح فتوكاتد منجر به احياي آب و تولید هیدروژن و حفره مثبت روی سطح الکترود کمکی منجر به اکسایش آب و تولید اکسیژن می شود. شکل ۵ منحنی پتانسیل روبشی خطی تحت قطع و وصل نور برای نمونههای عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف را نشان میدهد. شکل داخلی مربوط به شکل ۵ مقدار جریان تحت نور در پتانسیل V ۰/۵ در دماهای مختلف را نشان میدهد. با قطع و وصل شدن نور، مقدار جریان اندازه گیری شده کم و زیاد می شود که در شکل ۵ بخوبی نشان داده شده است. در پتانسیل V ۰/۵- با وصل شدن نور مقدار جریان زیاد شده است(علامت منفی نشان دهنده جریان کاتدی میباشد). با اندازه گیری مقدار افزایش جریان در پتانسیل ۰/۵ V بعد از وصل شدن نور در نمونههای عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف شکل داخلی مربوط به شکل ۵ حاصل گردید. همچنان که از شکل داخلی مربوط به شکل ۵ مشخص می باشد مقدار جریان تحت نور در دمای C° ۴۵۰ بیشترین مقدار می باشد Cu₂O-CuO). علت این امر وجود لایه دوتایی (۷۳۱ μA.cm⁻²) با ضخامت بهینه در دمای C° ۴۵۰ میباشد. در دمای بیشتر از مقدار فاز $\mathrm{Cu_2O}$ خیلی کم می شود و تبدیل به تک فاز $^\circ\mathrm{Cu}$

$$E_{CB} = \chi - E^{e} - 0.5E_{g} \qquad (\Delta)$$

$$E_{VB} = E_{CB} + E_g \tag{(5)}$$

که χ الکترونگاتیویته نیمه هادی و [•]E انرژی الکترونهای آزاد در مقیاس استاندارد هیدروژن (V eV) و $_g E$ گاف نوار انرژی می باشد. الکترونگاتیویته O_2O و Cu v به ترتیب به مقدار V eV و 774 و 7/۷۳ میباشد[۲۴]. با استفاده از روابط ۵ و ۶ موقعیت لبه نوار هدایت و ظرفیت Cu v به ترتیب به مقدار Ve V eV به ترتیب به مقدار Ve V میا مهر و موقعیت لبه نوار هدایت و ظرفیت Cu v به ترتیب به مقدار V eV و موقعیت لبه نوار هدایت و ظرفیت Cu v به ترتیب به مقدار N eV و موقعیت لبه نوار هدایت و ظرفیت Cu v می به ترتیب به مقدار شده A/۰ و موقعیت لبه نوار هدایت و ظرفیت Cu v v V ev v و موقعیت لبه نوار هدایت و ظرفیت Cu v v ev و v v و مولا V ev و موقعیت لبه نوار هدایت o cu v و cu v و مرار و v v می مواد نسبت به پتانسیل احیای هیدروژن منفی تر میباشند، الکترون ایجاد شده در اثر نور منجر به احیای هیدروژن در فصل مشترک ایجاد شده در اثر نور منجر به احیای هیدروژن در فصل مشترک هدایت مربوط به Cu cu cu v به پتانسیل احیای هیدروژن کمتر از





شکل ∀: منحنی مات-شاتکی (a) Cu₂O و Cu₂O. (b) (b) Cu₂O.

CuO می شود. علت افزیش جریان تحت نور در لایه دوتایی جذب بیشتر نور و انتقال راحت تر الکترون به سطح به واسطه لایه CuO می باشد.

به منظور بررسی رفتار انتقال بار در پوشش تک لایه CuO و دولايه Cu₂O-CuO آزمون طيف سنجى امپدانس الكتروشيميايي انجام شد. طيفسنجي اميدانس الكتروشيميايي يك روش موثر جهت مطالعه رفتار انتقال بار الكترود مي باشد. طيف سنجي اميدانس الکتروشیمیایی در پتانسیل ثابت V ۶/۰- نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl در حالت تاریکی انجام شد. شکل ۶ منحنی نایکویست در محدوده فرکانسی Hz -۱۰^۵ از نشان میدهد. منحنی نایکویست نشان دهنده وجود دو شبه دایره میباشد که بیانگر فرآيند انتقال بار در فصل مشترك الكترود-محلول و داخل الكترود می باشد [۲۶]. شبه دایره در فرکانس های زیاد و کم به ترتیب مربوط به امیدانس در فصل مشترک الکترود-الکترولیت و در داخل الكترود مى باشد [٢٧]. قطر دايره در فركانس بالا بيانگر مقاومت انتقال بار در فصل مشترک الکترود-محلول و قطر دایره در فرکانس پايين بيانگر مقاومت در قسمت داخلى الكترود مىباشد. مقاومت در قسمت داخلی الکترود می تواند ناشی از مقاومت در ناحیه بار فضایی و یا مقاومت در فصل مشترک پوشش و زیرلایه باشد [۲۸]. Cu_2O بنابراین با مقایسه قطر دایره در فرکانسهای بالا مربوط به و Cu₂O-CuO می توان به این نتیجه رسید که مقاومت انتقال بار در صورت عملیات حرارتی در دمای C° ۴۵۰ به دلیل ایجاد CuO کاهش می یابد. کم بودن مقاومت انتقال بار در سطح CuO منجر به تسريع شدن واكنش الكتروشيميايي احياي هيدروژن مي شود. همچنین طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی در فرکانس ثابت ۱ kHz در پتانسیلهای مختلف انجام شده است. با اندازه گیری ظرفیت خازن در پتانسیلهای مختلف و با استفاده از رابطهی مات-شاتکی می توان نوع نیمه هادی، پتانسیل نوار مسطح و چگالی حامل بار فتوكاتد اكسيد مس را بدست آورد. رابطه ی مات-شاتكی بصور

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{e\varepsilon\varepsilon_0 N_A} (E - E_{fb} - \frac{KT}{e})$$

که در آن $_{0}^{\circ}$ نفوذپذیری خلاء، NA چگالی حامل بار، $_{0}^{\circ}$ ثابت دیالکتریک نیمه هادی، e بار الکترون، E پتانسیل اعمالی، Efb پتانسیل نوار مسطح و kT/e یک عبارت دمایی میباشد. جهت رسم منحنی مات-شاتکی معکوس مربع پتانسیل بر حسب پتانسیل در فرکانس ثابت kHz معکوس مربع پتانسیل بر حسب پتانسیل در فرکانس ثابت kHz معکوس مربع پتانسیل بر حسب پتانسیل نسیل نسیل ناسی منحنی مات-شاتکی Na₂SO₄ (N M) در محلول (N M) Na₂SO₄ (i M) در محلول زم N) نشان دهنده شیب منفی میباشد که بیانگر نیمه هادی نوع مثبت میباشد. چی

Cu₂O-CuO و Cu₂O و Cu₂O و Cu₂O و Cu₂O و Cu₂O میباشد. به ترتیب به مقدار V vs Ag/AgCl و 0 /^{0} میباشد. همچنین با استفاده از شیب منحنی چگالی حامل بار Cu₂O و Cu₂O-CuO بدست آمدند که به ترتیب به مقدار 1 /۰۱× 1 و 1 /۰× 1 /۰ میباشند. مقدار پتانسیل نوار مسطح و چگالی حامل بار بدست آمده در این تحقیق با مقادیر ارائه شده در مقالات همخوانی دارد [۳۵, ۳۱]. یکی دیگر از دلایل بیشتر بودن مقدار جریان تحت نور در فتوکاتد Cu₂O-CuO مقدار بیشتر چگالی حامل بار در آن نور در فتوکاتد Cu₂O-CuO میباشد.

٤- نتیجه گیری

در این تحقیق لایه اکسید مس ایجاد گردید و با استفاده از آن به عنوان فتوکاتد، تجزیه آب تحت نور مرئی مورد مطالعه قرار گرفت. لایه Cu₂O به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی تحت پتانسیل ثابت ۷ ۴/۰- سنتز شد و به لحاظ ساختار کریستالی، ریختشناسی سطحی، خواص الکتروشیمیایی و فتوالکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. میتوان نتایج زیر را به صورت موردی و خلاصه بیان نمود:

۱. الگوی پراش اشعه ایکس بیانگر وجود فاز Cu_2O در نمونه رسوب رسوبدهی شده و فاز CuO در نمونه عملیات حرارتی شده میباشد. هر چند بر اساس مطالعات مرجع [۱۹] میتوان وجود فاز Cu_2O را علاوه بر CuO در نمونه عملیات حرارتی شده در نظر گرفت.

 ۲. ریختشناسی سطحی در نمونه یسنتز شده و عملیات حرارتی شده متفاوت می باشد و اندازه دانه ها در هر دو حالت در محدوده نانومتری می باشد.

۳. مقدار جریان تحت نور در نمونههای عملیات حرارتی شده در دماهای مختلف با استفاده از پتانسیل روبشی خطی تحت قطع و وصل نور تعیین شدند. که در نمونه عملیات حرارتی شده در دمای $^{\circ}$ ۴۵۰ به بیشترین مقدار خود رسید. (2 ۹۸.cm در پتانسیل V $^{\circ}$ - ۰/۵ V

۴. منحنی نایکویست مربوط به Cu₂O و Cu₂O–Cu₂O با استفاده از طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی رسم شدند که نشان دهندهی دو نیم دایره مربوط به فرآیند انتقال بار در سطح الکترود–الکترولیت و داخل الکترود می باشد که کاهش قطر دایره در نمونه عملیات حرارتی شده نشان دهنده کاهش انتقال بار در آن می باشد.

با رسم منحنی مات-شاتکی مقدار پتانسیل نوار مسطح در نمونهی سنتز شده و عملیات حرارتی شده به ترتیب به مقدار ۷ ۰/۱۹ و ۷ ۲۲/۰نسبت به الکترود مرجع Ag/AgCl تعیین شدند و همچنین (Y)

٥- مراجع

[1] Ni, M., et al., A review and recent developments in photocatalytic water-splitting using TiO2 for hydrogen production, Renewable and Sustainable Energy Reviews 11 (2007), 401-425.

[2] Moniz, S.J., et al., Visible-light driven heterojunction photocatalysts for water splitting–a critical review, Energy & Environmental Science 8 (2015), 731-759.

[3] Guedes, M., J.M. Ferreira, and A.C. Ferro, A study on the aqueous dispersion mechanism of CuO powders using Tiron, Journal of Colloid and interface Science 330(2009), 119-124.

[4] Hsueh, T.-J., et al., Cu 2 O/n-ZnO nanowire solar cells on ZnO: Ga/glass templates, Scripta Materialia 57 (2007), 53-56.

[5] Hsu, Y.-K., et al., Fabrication of homojunction Cu 2 O Solar Cells by electrochemical deposition, Applied Surface Science 354 (2015), 8-13.

[6] Jeong, S., et al., Electrodeposited ZnO/Cu 2 O heterojunction solar cells, Electrochimica Acta 53 (2008), 2226-2231.

[7] Li, Y. and G.A. Somorjai, Nanoscale advances in catalysis and energy applications, Nano letters 10(2010), 2289-2295.

[8] Hu, C.-C., J.-N. Nian, and H. Teng, Electrodeposited p-type Cu 2 O as photocatalyst for H 2 evolution from water reduction in the presence of WO 3, Solar Energy Materials and Solar Cells 92 (2008), 1071-1076.

[9] Mohamed, R., D. McKinney, and W. Sigmund, Enhanced nanocatalysts, Materials Science and Engineering: R: Reports 73 (2012), 1-13.

[10] Jia, W., et al., Synthesis and characterization of novel nanostructured fishbone-like Cu (OH) 2 and CuO from Cu 4 SO 4 (OH)
6, Materials Letters 63 (2009), 519-522.

[11] Ray, S.C., Preparation of copper oxide thin film by the sol–gellike dip technique and study of their structural and optical properties, Solar energy materials and solar cells 68 (2001), 307-312.

[12] Lan, X., et al., Morphology-controlled hydrothermal synthesis and growth mechanism of microcrystal Cu2O, CrystEngComm 13 (2010), 633-636.

[13] Pavan, M., et al., TiO 2/Cu 2 O all-oxide heterojunction solar cells produced by spray pyrolysis, Solar Energy Materials and Solar Cells 132 (2015), 549-556.

[14] Kim, T.G., et al., The study of post annealing effect on Cu 2 O thin-films by electrochemical deposition for photoelectrochemical applications, Journal of Alloys and Compounds 612 (2014), 74-79.
[15] Deng, C., et al., One-pot sonochemical fabrication of hierarchical hollow CuO submicrospheres, Ultrasonics sonochemistry 18 (2011), 932-937.

[16] Solymosi, F. and E. Krix, Catalysis of solid phase reactions effect of doping of cupric oxide catalyst on the thermal decomposition and explosion of ammonium perchlorate, Journal of Catalysis 1 (1962), 468-480.

[17] Wang, H., et al., Preparation of CuO nanoparticles by microwave irradiation, Journal of crystal growth 244 (2002), 88-94.

[18] Li, C., et al., Preparation and characterization of Cu (OH)

مقدار چگالی حامل بار به ترتیب به مقدار ۱۰^{۱۸}×۱/۳ و ۲۰۰×۳/۰۵ بدست آمدند.

قدردانى

نویسندگان این مقاله از مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین بخاطر حمایتهای انجام شده تشکر و قدردانی مینمایند.

1411

2 and CuO nanowires by the coupling route of microemulsion with homogenous precipitation, Solid State Communications 150 (2010), 585-589.

[19] Du, F., Q.-Y. Chen, and Y.-H. Wang, Effect of annealing process on the heterostructure CuO/Cu2O as a highly efficient photocathode for photoelectrochemical water reduction, Journal of Physics and Chemistry of Solids 104 (2017), 139-144.

[20] Yang, Y., Y. Li, and M. Pritzker, Control of Cu 2 O Film Morphology Using Potentiostatic Pulsed Electrodeposition, Electrochimica Acta 213 (2016), 225-235.

[21] ÇAVUŞOĞLU, H., Band-gap Control of Nanostructured CuO Thin Films using PEG as a Surfactant European Journal of Science and Technology 13 (2018), 124-128.

[22] Walsh, A. and K.T. Butler, Prediction of Electron Energies in Metal Oxides, Accounts of Chemical Research 47 (2014), 364-372.
[23] Heidari, G., M. Rabani, and B. Ramezanzadeh, Application of CuS–ZnS PN junction for photoelectrochemical water splitting, International Journal of Hydrogen Energy 42(2010), 9545-9552.

[24] Sriram SUBRAMANIAN, R.V., Chandiramouli RAMANA-THAN, Structural and Electronic Properties of CuO, CuO2 and Cu2O Nanoclusters – a DFT Approach, MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA) 21 (2015), 173-178.

[25] Nguyen, P.D., T.M. Duong, and P.D. Tran, Current progress and challenges in engineering viable artificial leaf for solar water splitting, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 2 (2017), 399-417.

[26] Saranya, M., et al., Hydrothermal growth of CuS nanostructures and its photocatalytic properties, Powder Technology 252 (2014), 25-32.

[27] Badia-Bou, L., et al., Water oxidation at hematite photoelectrodes with an iridium-based catalyst, The Journal of Physical Chemistry C 117 (2013), 3826-3833.

[28] Annamalai, A., et al., Role of graphene oxide as a sacrificial interlayer for enhanced photoelectrochemical water oxidation of hematite nanorods, The Journal of Physical Chemistry C 119 (2015), 19996-20002.

[29] Zhang, Z. and P. Wang, Highly stable copper oxide composite as an effective photocathode for water splitting via a facile electrochemical synthesis strategy, Journal of Materials Chemistry 22 (2012), 2456-2464.

[30] Cao, D., et al., Facile surface treatment on Cu 2 O photocathodes for enhancing the photoelectrochemical response, Applied Catalysis B: Environmental 198 (2016), 398-403.

[31] Dubale, A.A., et al., Heterostructured Cu 2 O/CuO decorated with nickel as a highly efficient photocathode for photoelectrochemical water reduction, Journal of Materials Chemistry A 3(2015), 12482-12499.